

OE750

极致质量控制，绝不妥协

HITACHI
Inspire the Next

日立



过程/质量控制

卓越的性能，不可思议的高效率

新型OE750是一款突破性的新型OES金属分析仪。其涵盖了金属元素的全部光谱，并具有同类产品中最低的检出限。

由于行业法规日益严格，供应链变得复杂以及更多地使用废料作为基础材料，因此铸造厂和金属制造商必须将杂质和痕量元素控制在最低ppm范围内。在过去，这一级别的OES对许多企业而言是遥不可及。日立分析仪器推出的新型OE750可改变这一现状。

日立的这款全新OES可用于分析所有主要合金元素，并识别金属中含量极低的杂质、痕量元素和关心元素，如钢中的氮。OE750的测量速度快、可靠性高且运营成本低，可进行高性价比的日常分析和全面质量控制，其性能可与更大、更贵的光谱仪媲美。

德国制造的OE750的设计离不开日立45余年的金属行业经验的支撑。从测量钢铁中的氮到铝中的磷，这款分析仪可提供满足当今严格规范所需的全面金属分析。日立分析仪器的OE750是可进行快速、全面的金属质量分析的经济适用仪器，可满足一切需求。





为什么选择 OE750?



值得信赖的结果

在同类产品中控制杂质和痕量元素的光学分辨率最高。



L综合成本低

负担得起的购买和运行成本，提供更贵分析仪器所具备的性能。



保持运行不间断

设计可靠，维护和标准化要求极低。



支持连续生产

分析速度快，启动时间短，可快速反馈熔液质量。



我们如何提高 性价比

这完全取决于技术。

OE750采用最先进的半导体探测器和新型光学概念（四项专利正在申请中）。这使得日立的OES光谱仪在同类产品中具有最高光学分辨率，因此您不必在高性能和低成本之间作出选择。

动态CMOS检测器的创新使用以及将光学系统直接接合至火花台可确保最佳照度以及119nm至766nm的波长范围。这包括从氢到铀的所有元素，用于全元素分析*。这种性能通常只适用于高端质量控制仪器，但OE750可通过创新、低氦和低功耗降低成本。

OE750在元素选择上具有极大的灵活性，能使操作适合未来需要。

最大可靠性和最短停机时间

OE750旨在保持运行不间断。其维护时间被缩至最小；例如，只需每隔几千次测量*清理一次火花台，标准化间隔通常是几周甚至几个月。由此可实现每周节省2个小时。

此外，新开发的数字火花光源将提供更好的可靠性以及每个元素的最佳能量激发脉冲，从而提高分析的精密度。

*根据应用的不同，可查阅我们的应用报告获取更多详情

支持质量控制的软件创新

SPARCFIRE

OE750的现代操作软件具有最先进的用户界面，旨在满足冶金专家的要求，但足够直观，缺乏经验的用户也可操作。

牌号数据库

OE750中预先安装有市面上最大的金属牌号数据库，可快速而轻松地鉴定牌号。日立的牌号数据库能提供70多个国家和标准中350,000多种材料的1,500多万条记录。只需几次点击，即可更改仪器的牌号数据库，无需耗费时间研究各种规范和牌号目录。

炉料校正

该软件会自动计算加入溶液中的合适材料量，使其符合规格。您不再需要依赖人类的专业知识，这大大加快了炉料校正过程。该软件还通过考虑可用的原材料和炉子容量，计算最具成本效益的熔液校正方法。

统计过程控制 (SPC)

SPC能确保轻松监控过程。如果熔体、过程或仪器超出规格，将及时发出通知。可为每个元素设置控制上限和控制下限，并查看每个元素在这些限制内的可视化表示。这意味着您可以在它们影响最终规格之前发现趋势，以减少报废和返工。此外，跟踪功能使得为客户或监管审计提供信息变得更加容易。

EXTOPE CONNECT

ExTOPE Connect 是一项高级数据管理和存储服务，它能够安全地存储结果、即时共享数据以及从任何计算机实时访问数据。它包无限免费和安全数据存储，用户可从一个集中位置管理多个站点的仪器群。

OE750 附带的软件使分析更快、更精确、更易于理解。这将提供有助于过程控制的结果分析，数据管理功能允许全面跟踪结果，并在审计时提供帮助。



SpArcfire



GRADE Database



SPC



ExTOPE Connect

技术参数



尺寸, 电路

高度/宽度/深度	425 mm / 535 mm / 760 mm
重量	82 kg
电源	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
最大功率	430 W
运行/待机	45 W / (50 W 光源开启)

光学系统

罗兰圆	采用帕邢-龙格装置
高分辨率多CMOS	优化的像素分辨率
波长范围	119 - 766 nm
焦距	400 mm

固态数字电源

频率	计算机控制参数
电压	80 - 1000 Hz
	250 - 500 V
	高能预燃技术 (HEPS)

读出系统

外部PC工作站	Microsoft® Windows® 用户界面
---------	--------------------------



降低运营成本

OE750的冲力远远超过其自身的重量，从而以一个可访问软件包为您提供昂贵分析仪的性能。此外，我们也降低了运行成本。具体原因如下：

低氦耗

| OE750的氦耗比之前型号减少10%，这是因为学系统的体积减少，火花周围的气流更好。

低能耗

| 由于创新的数字火花光源和智能电源管理，此款光谱仪的能耗低于以前型号的一半。

我们的服务

我们的全球服务中心提供全方位的技术支持。

- | 技术服务台
对您的问题快速解答。
- | 耗材与附件
从电极到备件套件。
- | 再认证与维护
确保您的分析仪能够年复一年地提供正确结果。
- | 培训
了解您的分析仪及其功能。
- | 延长保修期
降低计划外成本。
- | 维修
实现高效快速周转。

更多信息

欲了解更多关于OE750的信息，请访问：
hhtas.net/oe750

更多信息欲了解更多直读光谱仪介绍，请访问：
www.hitachi-hightech.com/hha

销售热线：400 621 5191



其他产品

45多年来，我们一直为制造业提供工业分析产品。

- | 手持式LIBS：最新技术，可在1秒内识别合金，不使用X射线。
- | 手持式XRF：快速可靠地对各种合金进行无损鉴定和分析。

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd. 所有。本出版物仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd. 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd. 承认所有商标和注册。

© Hitachi High-Tech Analytical Science
版权所有，2018(年)。保留所有权利。

 Science for
a better tomorrow



348399 QM08

CERT #9397.01